

Vide ▶ Couches minces PVD ▶ Contrôle d'étanchéité ▶ Plasma



Dépôt de couches minces PVD très grandes surfaces

LINE20000



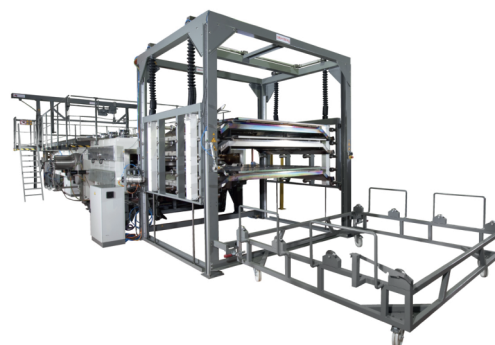
Produit couches minces : dépôt très grandes surfaces

Fer de lance de notre vision future des équipements de dépôt de couches minces, le bâti LINE20000 reprend le principe fonctionnel du système LINE440 avec la **réalisation du dépôt par défilement du substrat sous les cathodes**. Pour réaliser ce système hors normes, nous avons bénéficié d'une aide au financement OSEO qui a permis le développement **des cathodes magnétron d'une longueur de cible de 2500 mm**.

Muni d'un maximum de huit cathodes, l'équipement offre une multitude de possibilités pour la réalisation d'empilements complexes sur des surfaces allant jusqu'à 2 m x 2 m. Le sas d'introduction est équipé d'une électrode d'effluage.

En amont du sas, une cassette externe ou "stacker" permet de stocker cinq plateaux porte-substrat en attente de traitement.

Ce bâti illustre parfaitement notre aptitude à réaliser des systèmes hors-normes et à relever des défis technologiques en gardant une parfaite maîtrise des coûts de fabrication.



Caractéristiques générales

Capacité machine :	2,0 x 2,1 m ²
Epaisseur pièce :	400 mm max
Charge maximale :	1500 kg
Activation de surface :	Oui, effluage
Uniformité du dépôt :	< +/- 5% ^[1]
Dépôt :	DC, DC pulsé, RF, MF
Vide limite de l'enceinte :	5.10 ⁻⁷ mbar ^[1]
Vitesse de défilement :	1 à 500 cm/mn
Pilotage machine automatique :	- Gestion des procédés - Traçabilité

^[1] Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

